

透明光刻胶厂家 光刻胶厂家 赛米莱德公司

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 透明光刻胶厂家 光刻胶厂家 赛米莱德公司 |
| 公司名称 | 北京赛米莱德贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼2层208 |
| 联系电话 | 15201255285 15201255285 |

产品详情

光刻胶分类

正性光刻胶和负性光刻胶

光刻胶可依据不同的产品标准进行分类。按照化学反应和显影的原理，光刻胶可分为正性光刻胶和负性光刻胶。如果显影时未曝光部分溶解于显影液，形成的图形与掩膜版相反，称为负性光刻胶;如果显影时曝光部分溶解于显影液，形成的图形与掩膜版相同，称为正性光刻胶。

在实际运用过程中，由于负性光刻胶在显影时容易发生变形和膨胀的情况，一般情况下分辨率只能达到2微米，透明光刻胶厂家，因此正性光刻胶的应用更为广泛。

如需了解更多光刻胶的相关信息，欢迎关注赛米莱德网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供、周到的服务。

硅片模具加工如何选择光刻胶呢？

注意事项：

若腐蚀液为碱性，则不宜用正性光刻胶；

看光刻机型式，金属光刻胶厂家，若是投影方式，用常规负胶时氮气环境可能会有些问题

负性胶价格成本低，正性胶较贵；

工艺方面：负性胶能很好地获得单根线，而正性胶可获得孤立的洞和槽；

健康方面：负性胶为有机溶液处理，光阻光刻胶厂家，不利于环境；正性胶属于水溶液，对健康、环境无害。

以上内容由赛米莱德为您提供，希望对行业的朋友有所帮助！

负性光刻胶简介

感光树脂经光照后，在曝光区能很快地发生光固化反应，使得这种材料的物理性能，特别是溶解性、亲合性等发生明显变化。经适当的溶剂处理，溶去可溶性部分，得到所需图像（见图光致抗蚀剂成像制版过程）。光刻胶广泛用于印刷电路和集成电路的制造以及印刷制版等过程。光刻胶的技术复杂，品种较多。根据其化学反应机理和显影原理，可分负性胶和正性胶两类。光照后形成不可溶物质的是负性胶；反之，对某些溶剂是不可溶的，光刻胶厂家，经光照后变成可溶物质的即为正性胶。利用这种性能，将光刻胶作涂层，就能在硅片表面刻蚀所需的电路图形。基于感光树脂的化学结构，光刻胶可以分为三种类型。光聚合型，采用烯类单体，在光作用下生成自由基，自由基再进一步引发单体聚合，后生成聚合物，具有形成正像的特点。光分解型，采用含有叠氮醌类化合物的材料，经光照后，会发生光分解反应，由油溶性变为水溶性，可以制成正性胶。光交联型，采用聚乙烯醇月桂酸酯等作为光敏材料，在光的作用下，其分子中的双键被打开，并使链与链之间发生交联，形成一种不溶性的网状结构，而起到抗蚀作用，这是一种典型的负性光刻胶。柯达公司的产品KPR胶即属此类。感光树脂在用近紫外光辐照成像时，光的波长会限制分辨率（见感光材料）的提高。为进一步提高分辨率以满足超大规模集成电路工艺的要求，必须采用波长更短的辐射作为光源。由此产生电子束、X射线和深紫外(<250nm)刻蚀技术和相应的电子束刻蚀胶，X射线刻蚀胶和深紫外线刻蚀胶，所刻蚀的线条可细至1 μm以下。

如需了解更多光刻胶的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

透明光刻胶厂家-光刻胶厂家-赛米莱德公司由北京赛米莱德贸易有限公司提供。

北京赛米莱德贸易有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京 大兴区 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。赛米莱德带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！